

美国 ASTM D5127 电子及半导体工业用纯水水质要求

项目	TypeE-1	TypeE-1. 1	TypeE-1. 2	TyPeE-2	TyPeE-3	TyPeE-4
线宽(μ m)	1. 0—0. 5	0. 5—0. 25	0. 25—0. 18	5—1	>5	—
电阻率	18. 2	18. 2	18. 2	17. 5	12	0. 5
热源(EU/ml)	0. 03	0. 03	0. 03	0. 25	—	—
TOC(μ g / L)	5	2	1	50	300	1000
溶解氧 DO(μ g / L)	1	1	1	—	—	—
蒸发残渣(μ g / L)	1	0. 5	0. 1	—	—	—
微粒(μ m) (SEM 检测)						
0. 1—0. 2	1000	1000	200			
0. 2—0. 5	500	500	100	3000		
0. 5—1. 0	50	50	1		10000	
10	—	—	—			100000
微粒(μ m) (在线检测)						
0. 05—0. 1	500	500	100			
0. 1—0. 2	300	300	50			
0. 2—0. 3	50	50	20			
0. 3—0. 5	20	20	10			
>0. 5	4	4	1			
细菌						
100ml Sample	1	1	1			
1L Sample	1	1	0. 1	10	10000	100000
硅(μ m)						
总硅	3	0. 5	0. 5	10	50	1000
溶解硅	1	0. 1	0. 05			
离子(μ g / L)						
NH4	0. 1	0. 1	0. 05	—	—	
Br	0. 1	0. 05	0. 02	—	—	
C1	0. 1	0. 05	0. 02	1	10	1000
F	0. 1	0. 05	0. 03	—	—	—
N03	0. 1	0. 05	0. 02	1	5	500
N02	0. 1	0. 05	0. 02	—	—	—
P04	0. 1	0. 05	0. 02	1	5	500
S04	0. 1	0. 05	0. 02	1	5	500
A1	0. 05	0. 02	0. 005	—	—	—
Ba	0. 05	0. 02	0. 001	—	—	—
B	0. 05	0. 02	0. 005	—	—	—
Ca	0. 05	0. 02	0. 002	—	—	—
Cr	0. 05	0. 02	0. 002	—	—	—
Cu	0. 05	0. 02	0. 002	1	2	500
Fe	0. 05	0. 02	0. 002	—	—	—

Pb	0.05	0.02	0.005	—	—	—
Li	0.05	0.02	0.003	—	—	—
Mg	0.05	0.02	0.002	—	—	—
Mn	0.05	0.02	0.002	—	—	—
K	0.05	0.02	0.002	1	2	500
K	0.05	0.02	0.005	2	5	500
Na	0.05	0.02	0.005	1	5	1000
Sr	0.05	0.02	0.001	—	—	—
zi	0.05	0.02	0.002	1	5	500

纯水